



溅射、沉积分离腔式真空薄膜沉积装置及其工作方法

文献类型: 专利

.....

作者 邓赞红¹; 方晓东¹; 邓赞红¹; 陶汝华¹

发表日期 2009

专利国别 中国

专利号 101386975

专利类型 发明

权利人 中国科学院安徽光学精密机械研究所

公开日期 2013-01-17

申请日期 2007

专利申请号 200710131996.X

源URL [http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/9976]

专题 合肥物质科学研究院_中科院安徽光学精密机械研究所

推荐引用方式 邓赞红,方晓东,邓赞红,等. 溅射、沉积分离腔式真空薄膜沉积装置及其工作方法, 溅射、沉积分离腔式真空薄膜沉积装置及其工作方法, 溅射、沉积分离腔式真空薄膜沉积装置及其工作方法, 溅射、沉积分离腔式真空薄膜沉积装置及其工作方法, 溅射、沉积分离腔式真空薄膜沉积装置及其工作方法, 溅射、沉积分离腔式真空薄膜沉积装置及其工作方法, 溅射、沉积分离腔式真空薄膜沉积装置及其工作方法, 溅射、沉积分离腔式真空薄膜沉积装置及其工作方法, 溅射、沉积分离腔式真空薄膜沉积装置及其工作方法, 溅射、沉积分离腔式真空薄膜沉积装置及其工作方法. 101386975. 2009-01-01.

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
258	84	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

